

半導体前駆体微量分析用高純度Pfa不活性ガスパージ装置、窒素およびアルゴン 対応パージシステム

商品番号: PL-CP429

前書き

半導体前駆体の検出および微量分析のための超高純度 PFA不活性ガスパージ装置。試料の酸化と汚染を防ぐため、重要なラボワークフローに合わせて窒素またはアルゴンパージ用に設計されています。専門的な研究向けの耐久性があり、耐薬品性に優れた構造です。

詳細を学ぶ



アプリケーション	説明	主なメリット
半導体前駆体テスト	ICP-MS分析前に酸化を防ぐため、有機金属前駆体をアルゴンでパージします。	ALD/CVD前駆体の正確な特性評価を保証します。
IC製造品質管理	プロセス化学薬品中の微量金属分析のための高純度ガスパージ。	材料由来の汚染を排除することにより、検出限界を下げます。
電池電解液研究	溶媒抽出およびパージ中に水分に敏感なリチウム電池コンポーネントを保護します。	一貫した電気化学テストのために電解液の安定性を維持します。
触媒合成	合成から分析への移行中に空気に敏感な触媒を管理します。	大気中の酸素や湿度による触媒被毒を防ぎます。
石油化学微量分析	窒素置換を使用して、複雑な炭化水素マトリックスから揮発性分画を除去します。	腐食性の硫黄含有化合物および溶媒に対する優れた耐性を発揮します。
高度なナノ材料調製	機能化ナノ粒子の試料調製中に不活性環境を維持します。	表面化学を保存し、意図しない表面酸化を防ぎます。
特殊ガス分析	高純度電子ガスのサンプリングおよび分析のための高純度インターフェースとして機能します。	大気漏れまたは材料のアウトガスによるバックグラウンドノイズを防ぎます。

機能	仕様詳細 (PL-CP429)
コア素材	超高純度PFA（パーフルオロアルコキン）
製造プロセス	精密CNC加工 / カスタムファブリケーション
標準容量	30ml（ご要望によりカスタムサイズ可能）
ガス互換性	窒素（N ₂ ）、アルゴン（Ar）、ヘリウム（He）、およびその他の不活性ガス
耐薬品性	すべての一般的な溶媒、強酸、および塩基に対する耐性
温度範囲	特定のアプリケーションの温度要件に基づいて完全にカスタマイズ可能
耐圧定格	標準的なガスパージ圧力用に最適化された設計（カスタマイズ可能）
接続ポート	既存のガスラインおよび分析機器インターフェースに合わせて調整
洗浄プロトコル	酸洗浄および高純度洗浄手順に対応